

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成20年6月26日(2008.6.26)

【公表番号】特表2003-533560(P2003-533560A)

【公表日】平成15年11月11日(2003.11.11)

【出願番号】特願2001-585209(P2001-585209)

【国際特許分類】

C 08 G	85/00	(2006.01)
C 08 J	5/18	(2006.01)
H 01 M	8/02	(2006.01)
C 08 L	101/02	(2006.01)

【F I】

C 08 G	85/00	
C 08 J	5/18	C E Z
H 01 M	8/02	B
C 08 L	101:02	

【手続補正書】

【提出日】平成20年5月8日(2008.5.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】一般式(1)の繰り返し単位を有する共有結合性およびイオン結合性架橋高分子、

【化1】



式中Qは結合、酸素、硫黄、

【化2】



であり、R基は芳香族または複素環式芳香族化合物の二価の基であり、

a) R基は一般式(4A)、(4B)、(4C)、(4D)、(4E)、(4F)、(4G)および/または(4H)の置換基を少なくとも一部に有し、

【化3】



式中、 R^1 基は互いに独立して結合または1～40の炭素原子を含む基で、好ましくは分岐状もしくは直鎖状アルキル基またはシクロアルキル基、またはアルキル化されていてよいアリール基であり、

M は水素、金属カチオン、好ましくは Li^+ 、 Na^+ 、 K^+ 、 Rb^+ 、 Cs^+ 、またはアルキル化されていてよいアンモニウムイオンであり、

X はハロゲンまたはアルキル化されていてよいアミノ基であり、

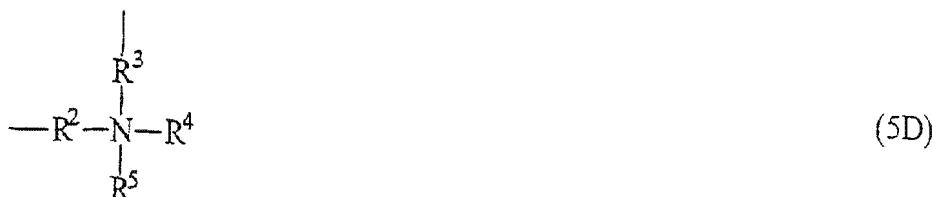
b) R 基は一般式(5A)および/または(5B)の置換基を少なくとも一部に有し、

【化4】



式中、 R^2 、 R^3 、 R^4 および R^5 は互いに独立して 1 ~ 40 の炭素原子を含む基であり、好ましくは分岐状もしくは直鎖状アルキル基またはシクロアルキル基、またはアルキル化されていてもよいアリール基であり、 R^2 、 R^3 および R^4 基の少なくとも二つは閉環して任意の芳香環を形成していてもよく、および / または R 基は少なくとも一部が一般式 (5C) および / または (5D) の基であり、

【化5】



および、

c) R 基は少なくとも一般式 (6) の架橋を一部に有し、

【化6】



該架橋は、少なくとも二つの R 基を互いに接合させ、 Y は 1 ~ 40 の炭素原子を有する基で、好ましくは分岐状もしくは直鎖状のアルキル基またはシクロアルキル基、またはアルキル化されていてもよいアリール基であり、

Z はヒドロキシリル基、一般式 (7) の基、

【化7】



または任意成分 H、C、O、N、S、P、もしくはハロゲン原子からなる、20 g / mol より大きい分子量を有する基で、また

mは2またはそれより大きい整数であることを特徴とする。